#### Ενόργανες Μέθοδοι Ανάλυσης Ορυκτών Υλών

### Φθορισιμετρία Ακτίνων Χ X-ray fluorescence (XRF)

Ιωάννης Ηλιόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής

Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022



$$2d\sin\vartheta = n\lambda$$

- Αν το λ είναι γνωστό (ή σταθερό) και η 4θ μπορεί να μετρηθεί → προσδιορίζεται το d, δηλ. η κρυσταλλική δομή του ορυκτού.
- Αν η τιμή του δ είναι γνωστή (και σταθερή) και η 4θ μπορεί να μετρηθεί → μπορεί να προσδιοσθεί το λ.



$$2d\sin\vartheta = n\lambda$$

#### Table 3: Wavelength dispersive X-ray techniques

Known	Sought	Measured	Method	Instrument type
d	λ	θ	X-ray flourescence	Spectrometer
λ	d	θ	X-ray diffraction	Diffractometer

### Η εξίσωση του Bragg

- Τα μήκη κύματος των διαφόρων χαρακτηριστικών ακτίνων Χ που προέρχονται από ένα σύνθετο υλικό θα πρέπει να δείχνουν ποια στοιχεία περιέχονται σε αυτό το υλικό.
- Η ένταση κάποιου χαρακτηριστικού «λ» είναι συνάρτηση (πολύπλοκη πολλές φορές) της αναλογίας συμμετοχής του συγκεκριμένου στοιχείου πού έδωσε την ακτινοβολία και της ποσότητας άλλων στοιχείων που συμμετέχουν στο υλικό.

 Οι σχέσεις μπορούν να προσδιορισθούν, και οι ακτίνες Χ που προέκυψαν από το υλικό μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό, ποιοτικό και ποσοτικό, των στοιχείων που υπάρχουν σ'αυτό.

- Φθορισιμετρία ακτίνων X (X-ray fluorescence, XRF).
- Μας δίνει χημικές πληροφορίες για την ολική σύσταση του υλικού.

- Δυνατότητα ανάλυσης όλων των υλικών: στερεά, υγρά, κονιοποιημένα, φιλτραρισμένα κ.α.
- Δυνατότητα προσδιορισμού πάχους και σύστασης
  λεπτών στρωμάτων επικάλυψης και υμενίων.
- Γρήγορη, ακριβής και μη-επεμβατική μέθοδος.
  Υψηλής πιστότητας και επαναληψιμότητας.
- Εφαρμογές: μέταλλα, τσιμέντα, πολυμερή, πλαστικά.
  Επίσης σε εξορυκτικές δραστηριότητες, στην ορυκτολογία, γεωλογία, περιβαλλοντικές αναλύσεις νερού και αποβλήτων, φαρμακευτική έρευνα.

### Πλεονεκτήματα της Φθορισιμετρίας ακτίνων Χ

- Απευθείας ανάλυση στερεών και υγρών δειγμάτων:
  μεγάλος εύρος εφαρμογών
- Σχετική γρήγορη προετοιμασία δειγματων
- Μη καταστρεπτική τεχνική (όσον αφορά το δείγμα)
- Απλά φάσματα ακτίνων Χ: δύσκολο να γίνει μεγάλο σφάλμα
- Σχετική γρήγορη διαδικασία της ανάλυσης
- Δυνατή τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική αναλυση
- Ακρίβής και σταθερή μέθοδος σε εύρος χρόνου
- Στοιχειακό εύρος ανάλυσης: Na (Be) to U

### Στάδια ανάλυσης στην εκπομπή ακτίνων Χ

- Εκπομπή της χαρακτηριστικής ακτινοβολίας από το δείγμα μέσω του βομβαρδισμού του με υψηλής ενέργειας φωτόνια, ηλεκτρόνια, πρωτόνια, κ.α.
- 2. Επιλογή μια χαρακτηριστικής γραμμής εκπομπής
- Ανίχνευση και επεξεργασίας της χαρακτηριστικής γραμμής ώστε να προκύψει η σχετική ένταση
- 4. Μετατροπή της έντασης σε στοιχειακή σύγκέντρωση

#### Στάδια ανάλυσης στην εκπομπή ακτίνων Χ

- Wavelength / Energy range: 0.2 to 20Å / 60 to 0.6keV
- K, L and some M-series
- Ποιοτική ανάλυση: θέση της κορυφής (peak)
- Ποσοτική ανάλυση: ένταση της κορυφής (peak)

### Τι είναι οι ακτίνες Χ

- Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που έχει διττό χαρακτήρα
  - Έχουν τις ιδιότητες των κυμάτων, δηλ. επιδεικνύουν τα τυπικά χαρακτηριστικά τους όπως π.χ. η περίθλαση
  - Έχουν τις ιδιότητες των σωματιδίων, (κατέχουν μια καλά προσδιορισμένη ενέργεια), δηλ. θα είναι ικανές να συγκρούονται με άλλα σωματίδια και άρα να αλληλεπιδρούν με αυτά

#### Τι είναι οι ακτίνες Χ



```
1nm = 10Å = 10^{-9}m = 10^{-6}mm
```

XRF analysis covers the following energy- respective wavelength range:

E = 0.11 - 60 keV  $\lambda = 11.3 - 0.02 \text{ nm}$ 

or

Elemental range from Berylium (Be) to Uranium (U)

- Προκύπτουν από την απώλεια ενέργειας που συνδέεται με την αλληλεπίδραση υψηλής ενέργεια ηλεκτρονίων ή ακτίνων Χ με άτομα
- Το φάσμα μια πηγής ακτίνων Χ εμπεριέχει δύο τύπους ακτινοβολίας Χ
  - Συνεχή ακτινοβολία (white radiation or Bremsstrahlung)
  - Χαρακτηριστική ακτινοβολία (photoelectric effect)
- Και οι δύο τύποι εξαρτώνται από το υλικό της ανόδου
- Όταν ένα δείγμα ακτινοβολείται από τις ακτίνες Χ που δημιουργούνται στην πηγή ακτίνων Χ, το φωτο-ηλεκτρικό φαινόμενο του κάθε στοιχείου που περιέχεται στο δείγμα καταγράφεται στο φάσμα
- Αυτό το φαινόμενο χρησιμοποιείται για την ανάλυση του δείγματος

#### **Continuous radiation**



#### Characteristic radiation = photoelectric interaction



X-ray emission lines = electron transitions

#### Siegbahn nomenclature



- Κατάλληλο παρασκεύασμα ακτινοβολείται με δέσμη πολυχρωματικής ακτινοβολίας ακτίνων Χ.
- Οι φθορίζουσες ακτίνες Χ που δημιουργούνται από δείγμα, περνούν από ένα σπεκτρόμετρο (φασματόμετρο),
- με το οποίο προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά μήκη κύματος και μετρώνται οι εντάσεις τους.





Figure 3. Three main interactions of X-rays with matter.

- Για να απομακρυνθεί ένα ηλεκτρόνιο θα πρέπει οι ακτίνες Χ να έχουν μεγαλύτερη ενέργεια από εκείνη του ηλεκτρονίου
- Αν απομακρυνθεί, η εισερχόμενη ακτινοβολία απορροφάται.
- Όσο μεγαλύτερη η απορρόφηση τόσο μεγαλύτερη και η φθορίζουσα ακτινοβολία.
- Η απόδοση φθορισμού είναι υψηλότερη όταν η ενέργεια του φωτονίου είναι μόλις πάνω από την ενέργεια που συγκρατεί το ηλεκτρόνιο



Figure 4. Production of characteristic radiation.

- Οι υψηλές ενέργειες απορροφώνται δύσκολότερα και παράγουν χαμηλό φθορισμό (εικ. 5).
- Αν η ενέργεια είναι χαμηλότερη και πλησιάζει εκείνη που συγκρατεί το ηλεκτρόνιο στην Κ στοιβάδα, απορροφάται περισσότερο η ακτινοβολία.
- Η απόδοση φθορισμού είναι υψηλότερη όταν η ενέργεια του φωτονίου είναι μόλις πάνω από την ενέργεια που συγκρατεί το ηλεκτρόνιο.
- Αν γίνει ακόμη χαμηλότερη η ενέργεια εμφανίζεται ένα χάσμα.



- Δεν προκαλούν όλα τα εισερχόμενα φωτόνια, φωτόνια φθορισμό.
- Απόδοση φθορισμού (fluorescence yield) καλείται ο λόγος των εκπεμπόμενων φωτονίων προς τα εισερχόμενα φωτόνια.
- Στην εικονα 6 γίνεται φανερό γιατί είναι δύσκολο να μετρήσουμε τα ελαφρά στοιχεία.



Figure 6. Fluorescence yield for K and L electrons.

- Το μέγεθος της απορρόφησης εξαρτάται από την ενέργεια της ακτινοβολίας, το μήκος της διαδρομής d, και την πυκνότητα του δείγματος.
- Αυξάνει όσο μεγαλώνει το d, η πυκνότητα του δείγματος και ο ατομικός αριθμός του στοιχείου, και όσο μειώνεται η ενέργεια της ακτινοβολίας.
- Η χαρακτηριστική ακτινοβολία που παράγεται κατευθείαν από τις ακτίνες Χ που προέρχονται από την πηγή → πρωτογενής φθορισμός, ενώ εκείνη που παράγεται από από τον πρωτογενή φθορισμό άλλων ατόμων → δευτερογενής φθορισμός



Table 1 gives the approximate analysis depth in various materials for three lines with different energies. Mg K $\alpha$  has an energy of 1.25 keV, Cr K $\alpha$  5.41 keV and Sn K $\alpha$  25.19 keV.

Material	Mg Ka	Cr Ka	Sn Ka
Lead	0.7	4.5	55
Iron	1	35	290
SiO <sub>2</sub>	8	110	0.9 cm
Li <sub>2</sub> B <sub>4</sub> O <sub>7</sub>	13	900	4.6 cm
H <sub>2</sub> O	16	1000	5.3 cm

Table 1. Analysis depth in µm (unless indicated otherwise) for three different lines and various materials.

#### Σκέδαση Compton (ασύμφωνη σκέδαση, incoherent)

- Μέρος των εισερχόμενων ακτίνων Χ σκεδάζεται (ανακλάται) αντί να προκαλεί χαρακτηριστική ακτινοβολία.
- Το φωτόνιο χάνει μέρος της ενέργειάς του την οποία παίρνει το ηλεκτρόνιο (το πόσο εξαρτάται από τη γωνία πρόσπτωσης).
- Η ενέργεια χάνεται με την σύγκρουση
  → ανελαστική σκέδαση





#### <u>Σκέδαση Rayleigh (σύμφωνη σκέδαση,</u> <u>coherent</u>)

- Συμβαίνει όταν φωτόνια συγκρούονται με ισχυρά δεσμευμένα ηλεκτρόνια.
- Τα ηλεκτρόνια αρχίζουν να παλινδρομούν με τη συχνότητα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας → εκπέμπουν ακτινοβολία
- Αυτό δίνει την εντύπωση σκέδασης της προσπίπτουσας ακτινοβολίας.
- Η ενέργεια δε χάνεται με την σύγκρουση → ελαστική σκέδαση



Figure 11. Rayleigh Scatter



- Δείγματα με ελαφρά στοιχεία δίνουν υψηλή σκέδαση τύπου Compton και χαμηλή τύπου Rayleigh, λόγω των ασθενώς δεσμευμένων ηλεκτρονίων.
- Όσο βαρύτερα γίνονται τα στοιχεία η σκέδαση ελαττώνεται: η Compton εξαφανίζεται εντελώς και παραμένει μόνο η Rayleigh.
- Το εύρος ενέργειας της Compton είναι μεγαλύτερα από το αντίστοιχο της Rayleigh.



Figure 12. Compton and Rayleigh scatter for light and heavy elements

Η δευτερογενής ακτινοβολία που εξέρχεται από την επιφάνεια ενός στερεού δείγματος το οποίο ακτινοβολείται από ακτίνες Χ (πρωτογενής ακτινοβολία) εμπεριέχει έναν αριθμό συστατικών:

- Το χαρακτηριστικό φάσμα με τις γραμμές των στοιχείων που περιέχονται στο δείγμα (που αποτελεί την αναλυτική πληροφορία που μας ενδιαφέρει)
- Τις ελαστικά και ανελαστικά σκεδασμένες εκδόσεις της πρωτογενούς ακτινοβολίας από την πηγή ακτίνων Χ, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών γραμμών του στοιχείου που αποτελεί το στόχο (άνοδο) μέσα στην πηγή και της συνεχούς ακτινοβολίας, και
- Πλασματικές ανακλάσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι γραμμές αθροίσματος (sum peaks) όταν για παράδειγμα ο ανιχνευτής αδυνατεί να διακρίνει δύο φωτόνια που φτάνουν ταυτόχρονα και αντ'αυτού καταγράφει ένα φωτόνιο με διπλάσια ενέργεια.

- Ένα σπεκτρόμετρο φθορισιμετρίας ακτίνων Χ πρέπει
  να μπορεί να διακρίνει τις διάφορες ανακλάσεις,
  - 🗸 να τις ταυτοποιεί, και
  - να μετρά την επιφάνειά τους ώστε να ποσοτικοποιεί τα δεδομένα.

- Δύο ειδών προσεγγίσεις → αντικατοπτρίζουν τη δυαδική σωματιδιακή – κυματική φύση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
- Δύο ειδών σπεκτρόμετρα:
  - Διασποράς ενέργειας (Energy Dispersive systems EDXRF): από Na έως U.
  - Διασποράς μήκους κύματος (Wavelength dispersive systems WDXRF): από Be έως U.



## Σπεκτρόμετρο ενεργειακής διασποράς



**Figure 4** An energy dispersive X-ray fluorescence analyzer designed for direct tube excitation using a low power side-window X-ray tube and fitted with a Si(Li) ED detector.

## Instrumentation for X-ray Spectrometry



### Σπεκτρόμετρο ενεργειακής διασποράς

- Στην περίπτωση του EDXRF η δευτερογενής ακτινοβολία που εκμπέμπεται από το ενεργοποιημένο άτομο εντός του δείγματος, θεωρείται ως ένα σωματίδιο (φωτόνιο ακτίνων X), του οποίου η ενέργεια είναι χαρακτηριστική του ατόμου από το οποίο προέρχεται.
- Αποτελείται από μία συσκευή στερεάς κατάστασης που μετρά την ενέργεια του φωτονίου και καταγράφει τον αριθμό των φωτονίων με γνωστές ενέργειες.
- Η καρδιά του συστήματος: ένας μονοκρύσταλλος Si εμπλουτισμένος με Li, ώστε τυχόν ηλεκτρονικές ατέλειες του μονοκρυστάλλου να περιορίζονται. Ο μονοκρύσταλλος διατηρείται εντός υγρού αζώτου ώστε να εμποδίζεται η διάχυση Li στο περιβάλλον και να μειώνεται ο ηλεκτρονικός θόρυβος της συσκευής.
- Τα τελευταία χρόνια καθιερώθηκε επίσης η χρήση μικρού μεγέθους ημιαγωγών, όπως Hgl2, Si-PIN, Si-DRIFT και CdZnTe, οι οποίοι ψύχονται μέσω θερμοηλεκτρικών κυκλωμάτων (Peltier) σε θερμοκρασίες ~-30°C.

### Σπεκτρόμετρο ενεργειακής διασποράς

- Όταν ένα φωτόνιο ακτίνων Χ κτυπά τον κρύσταλλο, η ολική του ενέργεια διαχέεται εντός του κρυστάλλου μέσω της δημιουργίας ζευγών ηλεκτρονίων – κενών θέσεων στον ημιαγωγό.
- Για έναν ανιχνευτή Si(Li) η δημιουργία κάθε τέτοιου ζεύγους απαιτεί ενέργεια 3,8 eV
- Συνεπώς ο αριθμός των ζευγών που δημιουργήθηκαν υπολογίζεται από την ενέργεια του προσπίπτοντος φωτονίου / 3,8
- Η εφαρμογή δυναμικού στον κρύσταλλο οδηγεί τα ηλεκτρόνια στον θετικό ακροδέκτη, δημιουργώντας ηλεκτρικό ρεύμα μεγέθους ανάλογου της ενέργειας του φωτονίου.
- Το ρεύμα προστίθεται στο ιστόγραμμα του αντίστοιχου καναλιού ενός πολυκάναλου αναλυτή, ο οποίος συνεπώς καταγράφει την άφιξη ενός φωτονίου εντός ενός συγκεκριμένου ενεργειακού εύρους (20 eV).
- Simultaneous τεχνική ανίχνευσης. Περιορισμένη ευαισθησία σε πολύ ελαφριά και πολύ βαριά στοιχεία.



**Figure 3** A wavelength dispersive X-ray fluorescence analyzer fitted with an endwindow X-ray rube and a gas proportional counter and scintillation counter mounted in tandem. The spectrometer incorporates a goniometer mechanism for maintaining the diffracting crysal and counter assembly at the correct  $\theta$  angle (not shown).

#### Instrumentation for X-ray Spectrometry Sequential WD-XRF – S8 TIGER



- A Sample
- **B** X-ray tube
- **C** Collimators
- **D** Crystals
- **E** Flow detector
- **F** Scintillation detector

- Ενώ στο EDXRF η μέτρηση και η ανίχνευση εκτελούνται ταυτόχρονα, στο WDXRF οι δύο διαδικασίες είναι ξεχωριστές.
- Οι δευτερογενείς ακτίνες Χ θεωρούνται ηλεκτρομαγνητικά κύματα, με μήκος κύματος χαρακτηριστικό του ατόμου από το οποίο προέρχονται.
- Το σύστημα ανίχνευσης αποτελείται από ένα σετ κατόπτρων (collimators), έναν κρύσταλλο περίθλασης και έναν ανιχνευτή.
- Οι ακτίνες Χ διέρχονται από ένα φίλτρο για να απομακρυνθεί η ακτινοβολία που δεν χρειάζεται, περνούν μέσα από τον collimator και μετά μέσα από μία μάσκα ώστε να περιοριστεί στην επιθυμητή περιοχή του δείγματος.
- Τα άτομα του δείγματος εκπέμπουν τις χαρακτηριστικές τους ακτίνες Χ που οδηγούνται επάνω σε μία συσκευή διασποράς, η οποία διαχωρίζει την δευτερογενή ακτινοβολία στα μήκη κύματος που την συνιστούν και ένας ανιχνευτής καταγράφει την ένταση της ακτινοβολίας συναρτήσει του μήκους κύματος

 Ως κρύσταλλοι χρησιμοποιούνται υλικά που έχουν αποστάσεις μεταξύ των δικτυωτών επιπέδων παρόμοιες του μήκους κύματος των ακτίνων Χ (1-10 Α). Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν κρύσταλοι ασβεστίτη ή ορυκτού άλλατος, τώρα LiF.

Πίνακας 3. Είδη αναλυτικών κρυστάλλων και στοιχεία που χρησιμοποιούνται.

Αναλυτικός	Επίπεδο	Απόσταση δικτυωτών	Χρήση			
κρύσταλλος	ανάκλασης	επιπέδων 2d (nm)	Γραμμές Κα	Γραμμές La		
LIE	100	0.402	Κ (Ζ=19) ως	Sn (Z=50) ως		
LII	100	0.402	l (Z=53)	U (Z=92)		
1:5	110	0.28.1	V (Z=23) ως	Ce (Z=32) ως		
LII		0,204	I (Z=53)	U (Z=92) *		
DET	002	0.875	Al (Z=13) ως			
FLI	002	0.072	K (Z=19)			
01/0.55			C.(Z=6) ως	ala il a fistalica acta activativa i		
0,0-55		J.J	Mg (Z=12)			
* Δίνει καλύτερη διακριτική ικανότητα από τον LIF (100) αλλά με χαμηλότερη ανακλαστικότητα.						

- Οι ανιχνευτές παίζουν το ρόλο μετρητή φωτονίων: παράγουν έναν ηλεκτρικό παλμό όταν το φωτόνιο απορροφάται από κάποιο υλικό, και ο αριθμός των παλμών ανά μονάδα χρόνου δίνει την ένταση της ακτίνας.
- συνήθως δύο ανιχνευτές: ένας αναλογικός ανιχνευτής ροής αερίου και ένας σπινθηρισμού.
- Οι απαριθμητές αερίου περιέχουν αδρανές αέριο διαπερατό από τις ακτίνες Χ, το οποίο ιονίζουν και τα φορτισμένα σωματίδια έλκονται προς τα ηλεκτρόδια προκαλώντας διαφορά δυναμικού → καταγραφή αρνητικού παλμού στο ενισχυτή. Αριθμός ηλεκτρονίων ανάλογος της ενέργειας της εισερχόμενης ακτινοβολίας και άρα του ύψους του παλμού. Για μεγάλα μήκη κύματος (δηλ. για ελαφριά στοιχεία).
- Στον απαριθμητή σπινθιρισμού βασικό ρόλο παίζει κρύσταλλος
  φωσφόρου που εκμπέμπει φως μόλις δεχτεί την πρόσκρουση ακτίνων
  Χ. Για μικρά μήκη κύματος (δηλ. για στοιχεία με μεγάλο ατομικό άριθμό).

#### Λυχνία ακτίνων Χ τύπου πλευρικού παραθύρου



#### Λυχνία ακτίνων Χ τύπου διέλευσης



- Συνήθεις συνθήκες λειτουργίας λυχνιών ακτίνων Χ:
  - ✓Ισχύς γεννήτριας: 2-4 kW
  - ✓Τάση λειτουργίας: 10-60 kV
  - ✓Ένταση ρεύματος: 2-100 mA
  - Για ανάλυση ελαφρών στοιχείων (ως τον P):
    μέγιστη ένταση, μικρή τάση
  - Για ανάλυση βαρύτερων στοιχείων (από το Ga και πάνω):
    μικρή ένταση, μεγάλη τάση
  - Για ανάλυση ενδιάμεσων στοιχείων (από το S ως τον Zn): ενδιάμεση ένταση και τάση

		•			Атоµіка	ός Αριθμ	ός		
χνία	10	20	30	40	50	60	70	80	) 90 (z)
G	F	τιν							U
₩	F	Sc Ti	CrNICu				XEAN S	asta N	U
Мо	F	ScTi	Cu Zn	Y Zr		a na alƙa	HITa		U
Au	F	Sc TI	V Cr Zn Ga	<b>6873</b> 687			- 3 <b>F</b> 1987 -		U
Rh	F S(	CI ScTI	Zn Ga	Mo Tc			Ta W		U
		□ : K	ίαλό		===: K	αλύτερο	)		Άριστο
ik. 40	). Επίλ	0;m 2.	υχνίας γ	ya avá	λυση.				

Oxide or element	Line	Crystal	Detector	Collimator	Peak angle (°)	Background offset (°)	Count time on peak (s)	Count time on background (s)
SiO <sub>2</sub>	Kα	PET(002)	FPC	Coarse	109.25	0	40	0
TiO <sub>2</sub>	Kα	LiF(200)	FPC	Fine	86.14	0	40	0
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Kα	PET(002)	FPC	Coarse	145.27	0	100	0
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Kα	LiF(200)	FPC	Fine	57.52	0	40	0
MnO	Kα	LiF(200))	KrSC	Fine	62.98	0	40	0
MgO	Kα	TLAP	FPC	Coarse	44.87	±0.80	200	200
CaO	Kα	LiF(200)	FPC	Coarse	113.16	0	40	0
Na <sub>2</sub> O	Kα	TLAP	FPC	Coarse	54.71	-1.20	200	200
K <sub>2</sub> O	Kα	LiF(200)	FPC	Fine	136.65	0	40	0
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Kα	GE(111)	FPC	Coarse	140.94	0	100	0
Rh	K Compton	LiF(200)	Scint	Fine	18.59	0	100	0
Nb	Kα	LiF(200)	Scint	Fine	21.37	±0.35	200	200
Zr	Kα	LiF(200)	Scint	Fine	22.53	±0.35	100	100
Y	Kα	LiF(200)	Scint	Fine	23.78	±0.40	100	100
Sr	Kα	LiF(200)	Scint	Fine	25.13	±0.40	100	100
Rb	Kα	LiF(200)	Scint	Fine	26.60	±0.60	100	100
Zn	Kα	LiF(200)	Scint	Coarse	41.79	±0.40	60	60
Cu	Kα	LiF(200)	Scint	Fine	45.02	±0.40	60	60
Ni	Kα	LiF(200)	Scint	Coarse	48.67	±0.60	60	60
Cr	Kα	LiF(200)	FPC	Fine	69.35	±0.50	60	60
Fe	Kα	LiF(220)	FPC	Fine	85.37	-0.40 + 0.70	40	40
V	Kα	LiF(220)	FPC	Fine	122.84	-0.50	60	5060
TiO <sub>2</sub>	Kα	LiF(200)	FPC	Fine	86.14	±0.50	40	40
Ce	Lα	LiF(220)	FPC	Coarse	127.92	±1.50	100	100
Ba	Lβ	LiF(220)	FPC	Coarse	128.53	±1.50	100	100

#### **EDXRF versus WDXRF**



#### Instrumentation for X-ray Spectrometry

The Comparison of Wavelength and Energy Dispersive Spectrometers

#### **WDXRF**

- Crystals + Collimators: separated X-rays enter the detector = sequential
- Total resolution: 3-100eV
- Typical measurement time: 2-10s per element
- Analytical range: Be to U
- Maximum Count-rates: 500-1000kcps per line
- High power tubes: 0.2-4kW
- Scintillation-, proportionaland sealed detectors

#### <u>EDXRF</u>

- All X-rays enter the detector at the same time = simultaneous, thus faster
- Total resolution: 125-200eV
- Typical measurement time: 10-100s for the whole spectrum
- Analytical range: Na to U
- Maximum Count-rates: 20-100kcps total
- Low power tubes: 5-50W
- Si(Li)-, Ge(Li), HPGe-, Pin diode or Si drift detectors (multi channel analysers)

#### Instrumentation for X-ray Spectrometry

The Comparison of Wavelength and Energy Dispersive Spectrometers

#### WDXRF

- High precision mechanics required
- Higher capital
- Precision: <0.05%
- level, but roughly one to two orders more sensitive
- Multisample handling
- Scanning for qualitative analysis
- Large dimensions, often "side-installations" are required (water, gas, ...)

#### EDXRF

- Mechanical simplicity
- Cheaper
- Precision: order of tenths of one percent
- Sensitivities: down to the ppm
  Sensitivities: down to the ppm level
  - Multisample handling
  - Faster qualitative analysis
  - Smaller, "can be brought to the sample"

## Physics of X-rays Comparison between a WD- and an ED Xray spectrum



# **DETECTION LIMITS**

- The lower limit of detection is generally defined as that concentration equivalent to 3 times the standard deviation of the background countrate.
- Three major factors will effect the detection limit for a given element:
  - the sensitivity s, of the spectrometer, for that element in terms of the counting rate per unit concentration
  - the background (blank) counting rate, Ib
  - the available time for counting peak and background photons, t
- The absolute sensitivity for wavelength dispersive spectrometers is generally spoken higher than for energy dispersive. That is because all of the detected radiation falls onto the detector at the same time for the latter.

$$LLD = \frac{3}{s} * \sqrt{\frac{I_b}{t}}$$

Instrumentation:

The Comparison of Wavelength and Energy Dispersive Spectrometers



#### **EDXRF versus WDXRF**

EDXRF and WDXRF spectrometers have their advantages and disadvantages (Table 2).

	EDXRF	WDXRF .		
Elemental range	Na 2. U (Sodium Uranium)	Be U (BerylliumUranimum)		
Detection limit	Less optimal for light	Good for Be and all heavier		
	elements	elements		
	Good for heavy elements			
Sensitivity	Less optimal for light	Reasonable for light elements		
	elements	Good for heavy elements		
	Good for heavy elements			
Resolution	Less optimal for light	Good for light elements		
	elements	Less optimal for heavy		
	Good for heavy elements	elements		
Costs	Relatively inexpensive	Relatively expensive		
Power consumption	51000 W	2004000 W		
Measurement	Simultaneous	Sequential/Simultaneous		
Critical moving parts	No	Crystal, Goniometer		

Table 2 Comparison of EDXRF and WDXRF spectrometers

EDXRF vs WDXRD: Ενδεικτικές τιμές ορίων ανίχνευσης (% για τα οξείδια και ppm για τα στοιχεία) για επιλεγμένα κύρια στοιχεία και ιχνοστοιχεία σε ανάλυση ολικού πετρώματος (από Jenkins, 1999).

Element	EDXRF	WXRF
Na <sub>2</sub> O	0.81	0.16
Ti	0.008	0.006
Mn	0.002	0.014
Rb	3.0	0.6
Sr	2.8	0.4
Y	3.8	0.4
Zr	2.8	1.1
Nb	2.8	1.3

#### Προετοιμασία δείγματος

- Αντιπροσωπευτικό, Όσον το δυνατόν ομογενές, προσεκτική διαχείριση
- Στερεά δείγματα: απαιτούν ελάχιστη προετοιμασία (καθαρισμό, στίλβωση)
- Κονιοποιημένα δείγματα: Χρήση υμενίου (φίλμ) ή δισκίου πίεσης (pressed pellet)
- Δισκία τήξης (fusion disks ή beads): απαιτείται η χρήση συλλιπάσματος (συνήθως Li<sub>2</sub>B<sub>4</sub>O<sub>7</sub>) και η τήξη σε 100-1200 °C.
- Υγρά δείγματα: έκχυση σε κυψέλες πολυβινιλίου με υποστήριξη λεπτών μεμβρανών. Προσοχή!!! Όχι ανάλυση σε κενό. Συνήθως απαραίτητη η χρήση Ηε για να αποφευχθεί η απορρόφηση της ακτινοβολίας Χ (κυρίως για τα ελαφρά στοιχεία) και η εξάτμιση.

#### Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση

- Για ποιοτική ανάλυση: αναγνώριση των χημικών στοιχείων που είναι υπεύθυνα για τα peaks (ανακλάσεις) και παρατήρηση των εντάσεών τους.
- Για ποσοτική ανάλυση: πιο σύνθετη προσέγγιση.

#### Βαθμονόμηση συστήματος

- Για ποσοτική μελέτη με τη μέθοδο XRF απαιτείται βαθμονόμηση του συστήματος με πρότυπα δείγματα, γνωστής περιεκτικότητας, στην περιοχή συγκεντρώσεων του υπό εξέταση δείγματος.
- Η ακρίβεια της βαθμονόμησης εξαρτάται ισχυρά από τη μορφολογία του δείγματος, η οποία πρέπει να συμπίπτει κατά το δυνατόν με εκείνη του προτύπου.
- Σημαντικό είναι επίσης να διατηρείται σταθερή η γεωμετρία κατά την παρασκευή και τοποθέτηση των δειγμάτων στο σύστημα XRF.
- Εναλλακτικά, ποσοτικές αναλύσεις μπορούν να γίνουν μέσω της μεθόδου Θεμελιωδών Παραμέτρων (Fundamental parameters technique), η οποία στηρίζεται σε θεωρητικούς υπολογισμούς που λαμβάνουν υπόψη τις αλληλεπιδράσεις της πρωτογενούς ακτινοβολίας με τα άτομα του δείγματος.

Η γενική μέθοδος: Σύγκριση εντάσεων επιλεγμένων γραμμών των στοιχείων του δείγματος με την ίδια ομάδα των προτύπων δειγμάτων.

#### I = k C

Ι: καθαρή ένταση μιας γραμμής εκμπομής, C: η συγκέντρωση του στοιχείου του αγνώστου δείγματος, k: σταθερά αναλογίας που καθορίζεται από τη συσχέτιση της έντασης προς τη συγκέντρωση ενός ή περισσοτέρων δειγμάτων προτύπων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: τα πρότυπα δείγματα πρέπει να έχουν σύσταση το δυνατόν πλησιέστερη με εκείνη του αγνώστου δείγματος!

#### Βαθμονόμηση συστήματος



TiO<sub>2</sub> x-ray intensity, counts per second

#### **Figure 11.12**

Calibration curve for x-ray fluorescence spectrometry of  $TiO_2$ . An unknown giving an intensity of 5,300 cps corresponds to a concentration of 1.23%.

#### Βαθμονόμηση συστήματος



#### Διορθώσεις σφαλμάτων - Παρεμβολές

- Νεκρού χρόνου (dead time): κενό χρόνου μεταξύ της ανταπόκρισης του ανιχνευτή σε ένα φωτόνιο (απαριθμ. ροής: 200ns, απαριθμ. σπινθηρισμού: 100ns). Λύση: θέτουμε ως dead time τα 300ns
- Επικάλυψης γραμμών: λόγω έλλειψης διακριτικότητας μεταξύ των φασματικών γραμμών από ένα όργανο XRF. Λύση: υπολογισμός παραγόντων επικάλυψης (καλύτερα ως συγκεντρώσεις) αναλύοντας συνθετικά πρότυπα που περιέχουν μόνο το παρεμβαλόμενος στοιχείο.
- Πολλαπλής εκμπομπής (παρεμβολές μήτρας): λόγω της πρόσθετης ακτινοβολίας ορισμένων στοιχείων του δείγματος από την δευτερογενή ακτινοβολία. Μεγαλύτερο το πρόβλημα όταν τα άγνωστα δείγματα και τα πρότυπα διαφέρουν σημαντικά.
- Απορρόφησης matrix (παρεμβολές μήτρας): δύο χημικώς διαφορετικά δείγματα θα έχουν αναγκαστικά διαφορετικό υλικό που θα περιβάλει τα χημικά στοιχεία από τα οποία δημιουργούνται οι ακτίνες Χ. Έτσι οι απορροφήσεις για την πρωτογενή και δευτερογενή ακτινοβολία θα διαφέρουν.

#### Διορθώσεις σφαλμάτων - Παρεμβολές

- Κοκκομετρίας δείγματος: καλύτερα αποτελέσματα με τη λεπτομερέστερη κονιοποίηση των δειγμάτων.
- <u>Θόρυβος (ακτινοβολίες background</u>): λόγω της κοσμικής ακτινοβολίας και διάχυσης ακτινοβολίας εντός του οργάνου.
- Γραμμές αθροίσματος (Sum peaks): Όταν δυο φωτόνια «χτυπήσουν» τον ανιχνευτή ταυτόχρονα, ο φθορισμός του ανιχνεύεται από τον ανιχνευτή και αναγνωρίζεται ως ένα φωτόνιο με διπλή ενέργεια. Κατά συνέπεια η εμφανιζόμενη κορυφή έχει διπλάσια ενέργεια X (Element keV).
- Γραμμές διαφυγής (Escape peaks): Τα άτομα του ανιχνευτή (Si, Ar, Ge) όταν χτυπηθούν από την εισερχόμενη ακτινοβολία θα εκπέμψουν την δική τους χαρακτηριστική ακτινοβολία. Η εισερχόμενη ακτινοβολία θα χάσει μέρος της ενέργειάς της, ισοδύναμο με την ενέργεια της χαρακτηριστικής γραμμής του στοιχείου του ανιχνευτή – Si keV (1,74 keV).